

Title (en)
METHOD FOR FORMING A BEZEL FOR CRIMPING ON A NON-DUCTILE SUBSTRATE AND OBJECT OBTAINED ACCORDING TO SAID METHOD

Title (de)
VERFAHREN ZUM BILDEN EINES CRIMP-FUTTERS AUF EINEM NICHT-LEITENDEN SUBSTRAT, UND MIT DIESEM VERFAHREN ERHALTENES OBJEKT

Title (fr)
PROCEDE DE FORMATION D'UN CHATON DE SERTISSAGE SUR UN SUBSTRAT NON DUCTILE ET OBJET OBTENU SELON CE PROCEDE

Publication
EP 3607851 A1 20200212 (FR)

Application
EP 19188365 A 20190725

Priority
CH 9702018 A 20180808

Abstract (fr)
La présente invention concerne un procédé de réalisation d'un châton (1) de sertissage d'un objet (O) sur une surface d'un substrat (2) non-ductile, ledit châton (1) comportant une ceinture (11) formant un siège d'appui d'un dit objet (O) et une pluralité de griffes déformables (12) réparties à la périphérie de la ceinture (11) et présentant une longueur telle qu'une extrémité libre au moins de chaque griffe puisse être repliée contre l'objet une fois ce dernier sis dans la ceinture, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :- Métallisation d'une portion au moins de la surface dudit substrat sur laquelle le châton doit être formé ;- Réalisation de la ceinture du châton dans la portion de surface du substrat préalablement métallisée ;- Réalisation des griffes par dépôt des fils métalliques (4) sur la portion de surface du substrat préalablement métallisée à la périphérie de la ceinture.L'invention concerne également un procédé de sertissage et une pièce d'horlogerie ou de joaillerie comportant un substrat non-ductile (2) et un châton de sertissage (1) d'un objet (O) agencé sur une surface dudit substrat obtenu selon le procédé de l'invention

IPC 8 full level
A44C 17/04 (2006.01); **G04B 29/02** (2006.01)

CPC (source: CH EP)
A44C 17/04 (2013.01 - CH EP); **G04B 19/10** (2013.01 - CH); **G04B 19/18** (2013.01 - EP); **G04B 29/02** (2013.01 - CH); **G04B 29/027** (2013.01 - EP)

Citation (applicant)
• EP 3291024 A1 20180307 - CSEM CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA [CH]
• EP 2579104 A2 20130410 - SUISSE ELECTRONIQUE MICROTECH [CH]

Citation (search report)
• [A] JP 3136526 U 20071101
• [A] JP 2009247484 A 20091029 - ANGELLY JAPAN KK
• [A] DE 3544429 A1 19870619 - JUWEDOR GMBH [DE]
• [A] EP 2796297 A1 20141029 - OMEGA SA [CH]
• [AD] EP 2579104 A2 20130410 - SUISSE ELECTRONIQUE MICROTECH [CH]

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3607851 A1 20200212; **EP 3607851 B1 20210331**; CH 715238 A1 20200214

DOCDB simple family (application)
EP 19188365 A 20190725; CH 9702018 A 20180808